LIQUID CRYSTAL ALIGNMENT LAYER, METHOD FOR MANUFACTURING LIQUID CRYSTAL ALIGNMENT LAYER, AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

Publication number: JP2003255349 (A)

Publication date:

2003-09-10

Inventor(s):

JO SHUNYO; IKEDA TOMIKI

Applicant(s):

JSR CORP

Classification:

- international:

G02F1/1337; C08G73/10; G02F1/13; C08G73/00; (IPC1-7): G02F1/1337;

C08G73/10

- European:

Application number: JP20020059199 20020305 **Priority number(s):** JP20020059199 20020305

Abstract of JP 2003255349 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing a liquid crystal alignment layer without using rubbing treatment, the liquid crystal alignment layer, and a liquid crystal display element using the same. ; SOLUTION: The method for manufacturing the liquid crystal alignment layer includes a step for irradiating a thin film of polyamic acid formed on a substrate with polarized or unpolarized radioactive rays and subsequently heating the formed thin film of polyamic acid having a liquid crystal aligning property. The obtained liquid crystal alignment layer and the liquid crystal display element using the same are also provided. ; COPYRIGHT: (C)2003,JPO

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-255349 (P2003-255349A)

(43)公開日 平成15年9月10日(2003.9.10)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ		デーマコート*(参考)
G02F	1/1337		G 0 2 F	1/1337	2H090
C08G	73/10		C 0 8 G	73/10	4 1 0 4 3

		審査請求 未請求 請求項の数5 〇L (全 9 頁)
(21)出顧番号	特暦2002-59199(P2002-59199)	(71)出願人 000004178
(22) 出顧日	平成14年3月5日(2002.3.5)	ジェイエスアール株式会社 東京都中央区築地五丁目 6 番10号
		(72)発明者 徐 春鷹
		東京都町田市金森874-1 都営金森第五 アパート 6 -509
		(72)発明者 池田 富樹
		神奈川県横浜市旭区中白根2-11-8
		(74)代理人 100080609
		弁理士 大島 正孝
		最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶配向膜、液晶配向膜の製造方法、および液晶表示素子

(57)【要約】

【課題】 ラビング処理によらず、液晶配向膜を製造す る方法、液晶配向膜およびそれを用いた液晶表示素子を 提供すること。

【解決手段】 基板上に形成したポリアミック酸薄膜に 偏光または非偏光の放射線を照射し、次いで形成された 液晶配向性を有するポリアミック酸薄膜を加熱して液晶 配向膜を製造する方法、得られた液晶配向膜およびそれ を用いた液晶表示素子。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に形成したポリアミック酸薄膜を 室温以上に加熱しつつ、偏光または非偏光の放射線を照 射して液晶配向性を付与することを特徴とする液晶配向 膜の製造方法。

【請求項2】 基板上に形成したポリアミック酸薄膜に 偏光または非偏光の放射線を照射し、次いで形成された 液晶配向性を有するポリアミック酸薄膜を加熱すること を特徴とする液晶配向膜の製造方法。

【請求項3】 請求項1または請求項2に記載された方法により製造された液晶配向膜。

【請求項4】 配向容易軸の方位が照射された偏光放射 線の電場ベクトルと平行である請求項3に記載の液晶配 向膜。

【請求項5】 請求項3または請求項4の液晶配向膜を 有する液晶表示素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶配向膜、その 製造方法および液晶表示素子に関する。さらに詳しく は、ラビング処理を行わずに、液晶配向膜を製造する方 法、製造された液晶配向膜およびそれを用いた液晶表示 素子に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、正の誘電異方性を有するネマチック型液晶を、液晶配向膜を有する透明電極付き基板でサンドイッチ構造にし、液晶分子の長軸が基板間で90度以上連続的に捻れるようにしてなるTN(Twisted Nematic)型、STN(Super Twisted Nematic)型液晶セルを有する液晶表示素子が知られている。

【0003】前記、液晶セルにおける液晶を配向させる 手段には、基板表面にポリイミドなどの有機膜を形成 し、次いでその有機膜表面をレーヨンなどの布材で一方 向にこすることにより液晶配向能を付与する(ラビング 処理を施す)方法、基板表面に酸化珪素を斜方蒸着する 方法、ラングミュア・ブロジェット法(LB法)を用い て長鎖アルキル基を有する単分子膜を形成する方法など があるが、処理する基板のサイズに制約があったり、液 晶の配向均一性が不十分なため、工業的には処理時間や 処理コストの面で有利なラビング処理による液晶の配向 が一般的である。

【0004】しかし、液晶の配向をラビング処理によって行うと、その工程中にほこりが発生したり、静電気が発生しやすいという問題点がある。静電気が発生すると、配向膜表面にほこりが付着し、表示不良が発生する原因となり、また、TFT(thin film transistor)素子を有する基板の場合、発生した静電気によってTFT素子の回路破壊が起こり、歩留まり低下の原因ともなる。さらに、今後ますます高精彩化される液晶表示素子においては、画素の高密度化にともなう基板表面の凹凸

のため、ラビング処理の均一性が問題になる。

【 O O O 5 】液晶セルにおける液晶を配向させる別の手段は、基板表面に形成したポリビニルシンナメート、ポリイミドなどの有機膜に直線偏光された紫外線を照射することにより、液晶配向能を付与するものである。このような光配向法によれば、静電気やほこりを発生することなく、均一な液晶配向を実現できる。

【0006】しかしながら、そのような方法で製造した 光配向膜は熱安定性が低いことが大きな欠点である。例 えば、ポリビニルシンナメート膜を光配向法に用いた場 合、100℃以上の温度で液晶配向が不安定になること が実験的に明らかにされている。

【0007】光配向膜の別の問題点は、プレチルト角を 得るのが困難であることである。例えば、ポリイミド膜 を用いて、従来の光配向法による処理を行った場合、プ レチルト角を得るためには、直線偏光された紫外線の照 射を照射方向を変えて2段階で行う必要があった。しか し、その場合、プロセス数が増加するのみならず、液晶 配向の安定性が低下しドメインが発生しやすくなるとい う問題があった。

【0008】従来の光配向法において、プレチルト角を得るために2段階の偏光照射が必要である理由は、照射した偏光放射線の電場ベクトルに直交する方向に、配向容易軸が形成されることにある。一方、シャット(Schatt)らは、照射した偏光放射線の電場ベクトルに平行な方向に配向容易軸が形成される材料を用いる場合には、1段階の偏光放射線照射によりプレチルト角が得られることを明らかにしている(Nature, 381, 212(1996))。このような材料の具体例として、前記文献はクマリン構造を有するポリメタクリレートを挙げているが、このような材料は、ポリイミド類に比較して電気的特性が劣っているという問題があった。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、熱安 定性および電気特性に優れた液晶配向膜の製造方法を提 供することにある。

【0010】本発明の他の目的は、基板表面に形成した 薄膜に、その電場ベクトルの方向が基板面から傾いてい る偏光した放射線を照射することにより、1段階の照射 プロセスで、プレチルト角を有する均一な液晶配向を実 現することのできる液晶配向膜の製造方法を提供するこ とにある。

【0011】本発明の他の目的は、本発明方法により得られる、上記の如き特性を備えた液晶配向膜を提供することにある。

【 0 0 1 2 】本発明のさらに他の目的は、本発明の液晶 配向膜を用いた液晶表示素子を提供することにある。

【0013】本発明のさらに他の目的および利点は、以下の説明から明らかになろう。

[0014]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、第1に、基板上に形成したポリアミック酸薄膜を室温以上に加熱しつつ、偏光または非偏光の放射線を照射して液晶配向性を付与することを特徴とする、液晶配向膜の製造方法によって達成される。

【0015】本発明によれば、第2に、本発明の上記目的および利点は、基板上に形成したポリアミック酸薄膜に偏光または非偏光の放射線を照射し、次いで形成された液晶配向性を有するポリアミック酸薄膜を加熱することを特徴とする、液晶配向膜の製造方法によって達成される。

【0016】本発明によれば、第3に、本発明の上記目的および利点は、本発明の上記方法により得られた液晶配向膜によって達成される。

【0017】本発明によれば、本発明の上記目的および 利点は、第4に、本発明の液晶配向膜を有する液晶表示 素子によって達成される。

[0018]

【発明の好ましい実施の形態】光配向膜の熱安定性が低い原因の1つは、その液晶配向能が熱緩和により失われやすいことにある。一般に、光配向法において十分な液晶配向能を付与するためには、配向膜材料として比較的柔軟な主鎖構造を有するポリマーを用いる必要がある。しかしながら、柔軟な主鎖構造のポリマーを用いた場合には、付与された液晶配向能が熱緩和により失われやすいため、配向膜としての熱安定性が不足するという問題が生じることになる。

【0019】ポリアミック酸は、加熱により容易にポリイミドに転換しうる前駆体ポリマーであり、生成するポリイミドより柔軟な主鎖構造を有することが知られている。そこで、本発明の方法によれば、このポリアミック酸の薄膜に放射線を照射することにより十分な液晶配向能を付与し、さらに、放射線照射と同時に、または、引き続いて行われるイミド化熱処理により、液晶配向能を損なうことなくこれをポリイミドに変換することができる。従って、本発明の方法によれば、熱緩和し難い、十分な液晶配向能を有する液晶配向膜を得ることができる。

【0020】さらに、驚くべきことに、本発明者は、本発明の方法により通常の液晶配向膜用ポリイミドからなる光配向膜を製造した場合、その配向容易軸の方向が照射した偏光放射線の電場ベクトルに平行な方向となることを見いだした。このため、本発明の方法によれば、電気特性に優れた液晶配向膜用ポリイミドを用いて、1段階の照射プロセスで、プレチルト角を有する均一な液晶配向を実現することのできる液晶配向膜を製造する事ができる。

[0021]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。

ポリアミック酸

本発明において用いられるポリアミック酸は、(イ)テトラカルボン酸二無水物と、(ロ)ジアミン化合物とを 重縮合させることにより得られる。このポリアミック酸は、照射する偏光または非偏光の放射線を吸収するもの であることが好ましい。例えば、放射線として偏光紫外線を用いる場合には、ポリアミック酸は当該紫外線の波 長域に吸収を有するものであることが好ましい。

【0022】本発明において用いられる(イ)テトラカ ルボン酸二無水物としては、例えば、2,3,5-トリ カルボキシシクロペンチル酢酸二無水物、ブタンテトラ カルボン酸二無水物、1,2,3,4-シクロブタンテ トラカルボン酸二無水物、1,3-ジメチル-1,2, 3,4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、1. 2,3,4-シクロペンタンテトラカルボン酸二無水 物、3,5,6ートリカルボキシノルボルナンー2一酢 酸二無水物、2,3,4,5-テトラヒドロフランテト ラカルボン酸二無水物、1,3,3a,4,5,9b-ヘキサヒドロー5ー(テトラヒドロー2,5ージオキソ -3-フラニル)-ナフト[1,2-c]-フラン-1,3-ジオン、5-(2,5-ジオキソテトラヒドロ フラル) -3-メチル-3-シクロヘキセン-1, 2-ジカルボン酸二無水物、ビシクロ[2.2.2]ーオク トー7-エン-2, 3, 5, 6-テトラカルボン酸二無 水物などの脂肪族および脂環式テトラカルボン酸二無水 物;ピロメリット酸二無水物、3,3',4,4'ービ フェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、1,4, 5,8-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、2, 3,6,7ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、 3,3',4,4'ーピフェニルエーテルテトラカルボ ン酸二無水物、3,3',4,4'-ジメチルジフェニ ルシランテトラカルボン酸二無水物、3,3',4, 4'ーテトラフェニルシランテトラカルボン酸二無水 物、1,2,3,4-フランテトラカルボン酸二無水 物、4,4'ービス(3,4ージカルボキシフェノキ シ) ジフェニルスルフィド二無水物、4,4'ービス (3,4-ジカルボキシフェノキシ)ジフェニルスルホ ン二無水物、4,4'ービス(3,4ージカルボキシフ ェノキシ)ジフェニルプロパン二無水物、3,3', 4,4'-パーフルオロイソプロピリデンテトラカルボ ン酸二無水物、3,3',4,4'ービフェニルテトラ カルボン酸二無水物、ビス(フタル酸)フェニルホスフ ィンオキサイド二無水物、p-フェニレンービス(トリ フェニルフタル酸) 二無水物、m-フェニレンービス (トリフェニルフタル酸) 二無水物、ビス (トリフェニ ルフタル酸)-4,4'-ジフェニルエーテル二無水 物、ビス(トリフェニルフタル酸)-4,4'-ジフェ ニルメタン二無水物などの芳香族テトラカルボン酸二無 水物を挙げることができる。

【0023】これらのうち、ピロメリット酸二無水物、

3,3',4,4'-ジフェニルスルホンテトラカルボ ン酸二無水物、1,4,5,8-ナフタレンテトラカル ボン酸二無水物、2,3,6,7ーナフタレンテトラカ ルボン酸二無水物、3,3',4,4'ービフェニルテ トラカルボン酸二無水物が好ましく、ピロメリット酸二 無水物および3,3',4,4'-ビフェニルテトラカ ルボン酸二無水物が特に好ましい。これらは単独でまた は2種以上を組み合わせて使用できる。また、(ロ)ジ アミン化合物としては、例えばpーフェニレンジアミ ン、m-フェニレンジアミン、4,4'-ジアミノジフ ェニルメタン、4,4'ージアミノジフェニルエタン、 4.4'ージアミノジフェニルスルフィド、4,4'ー ジアミノジフェニルスルホン、3,3'ージメチルー 4, 4'-ジアミノビフェニル、4, 4'-ジアミノベ ンズアニリド、4,4'ージアミノジフェニルエーテ ル、1、5-ジアミノナフタレン、5-アミノー1-(4'-アミノフェニル)-1,3,3-トリメチルイ ンダン、6-アミノ-1-(4'-アミノフェニル)-1,3,3-トリメチルインダン、3,4'ージアミノ ジフェニルエーテル、2,2-ビス(4-アミノフェノ キシ)プロパン、2,2-ビス[4-(4-アミノフェ ノキシ)フェニル]プロパン、2,2-ビス[4-(4 ーアミノフェノキシ)フェニル]ヘキサフルオロプロパ ン、2,2ービス(4-アミノフェニル)へキサフルオ ロプロパン、2, 2-ビス[4-(4-アミノフェノキ シ)フェニル]スルホン、1,4-ビス(4-アミノフ ェノキシ) ベンゼン、1,3-ビス(4-アミノフェノ キシ) ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノフェノキ シ)ベンゼン、9、9ービス(4ーアミノフェニル)ー 10-ヒドロアントラセン、2,7-ジアミノフルオレ ン、9,9-ビス(4-アミノフェニル)フルオレン、 4,4'-メチレンービス(2-クロロアニリン)、

$$NH_2$$
 NH_2 (1)

【0025】などの芳香族ジアミン;ジアミノテトラフェニルチオフェンなどのヘテロ原子を有する芳香族ジアミン;1,1-メタキシリレンジアミン、1,3-プロパンジアミン、テトラメチレンジアミン、ペンタメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ヘプタメチレンジアミン、オクタメチレンジアミン、ノナメチレンジアミン、4,4-ジアミノヘプタメチレンジアミン、1,4-ジアミノシクロヘキサン、イソホロンジアミン、テトラヒドロジシクロペンタジエニレンジアミン、ヘキサヒドロー4,7-メタノインダニレンジメチレンジアミ

2, 2', 5, 5'ーテトラクロロー4, 4'ージアミ ノビフェニル、2,2'ージクロロー4,4'ージアミ ノー5,5'ージメトキシビフェニル、3,3'ージメ トキシー4,4'ージアミノビフェニル、1,4.4' - (p-フェニレンイソプロピリデン) ビスアニリン、 4,4'-(m-フェニレンイソプロピリデン)ビスア ニリン、2,2'ービス[4-(4-アミノー2ートリ フルオロメチルフェノキシ)フェニル] ヘキサフルオロ プロパン、4,4'ージアミノー2,2'ービス(トリ フルオロメチル) ビフェニル、4,4'ービス[(4-アミノー2ートリフルオロメチル)フェノキシ]ーオク タフルオロビフェニル、1ードデカノキシー2,4ージ アミノベンゼン、1-テトラデカノキシー2,4-ジア ミノベンゼン、1-ペンタデカノキシー2,4-ジアミ ノベンゼン、1ーヘキサデカノキシー2,4ージアミノ ベンゼン、1-オクタデカノキシ-2,4-ジアミノベ ンゼン、1-コレステリルオキシ-2,4-ジアミノベ ンゼン、1-コレスタニルオキシー2,4-ジアミノベ ンゼン、ドデカノキシ(3,5-ジアミノベンゾイ ル)、テトラデカノキシ(3,5-ジアミノベンゾイ ル)、ペンタデカノキシ(3,5-ジアミノベンゾイ ル)、ヘキサデカノキシ(3,5-ジアミノベンゾイ ル)、オクタデカノキシ(3,5-ジアミノベンゾイ ル)、コレステリルオキシ(3,5-ジアミノベンゾイ ル)、コレスタニルオキシ(3,5-ジアミノベンゾイ ル)、(2,4-ジアミノフェノキシ)パルミテート、 (2,4-ジアミノフェノキシ)ステアリレート、 (2, 4-ジアミノフェノキシ) -4-トリフルオロメ チルベンゾエート、下記式(1)および(2)で表され る化合物

[0024]

【化1】

ン、トリシクロ [6.2.1.0²,7] ーウンデシレン ジメチルジアミン、4,4'ーメチレンビス (シクロへ キシルアミン) などの脂肪族および脂環式ジアミン;ジ アミノヘキサメチルジシロキサンなどのジアミノオルガ ノシロキサンが挙げられる。

【0026】これらのうち、p-フェニレンジアミン、4,4'-ジアミノジフェニルメタン、3,3'-ジメチル-4,4'-ジアミノビフェニル、1,5-ジアミノナフタレン、2,7-ジアミノフルオレン、4,4'-(<math>p-フェ

ニレンイソプロピリデン) ビスアニリン、2,2-ビス [4-(4-アミノフェノキシ)フェニル] ヘキサフル オロプロパン、2,2-ビス(4-アミノフェニル)へ キサフルオロプロパン、2,2'-ビス[4-(4-ア ミノー2ートリフルオロメチルフェノキシ)フェニル] ヘキサフルオロプロパン、4,4'ージアミノー2, 2'ービス(トリフルオロメチル)ビフェニル、4, 4'ービス[(4ーアミノー2ートリフルオロメチル) フェノキシ]ーオクタフルオロビフェニル、1ーヘキサ デカノキシー2, 4-ジアミノベンゼン、1-オクタデ カノキシー2, 4-ジアミノベンゼン、1-コレステリ ルオキシー2, 4ージアミノベンゼン、1ーコレスタニ ルオキシー2, 4-ジアミノベンゼン、ヘキサデカノキ シ(3,5-ジアミノベンゾイル)、オクタデカノキシ (3,5-ジアミノベンゾイル)、コレステリルオキシ (3,5-ジアミノベンゾイル)、コレスタニルオキシ (3,5-ジアミノベンゾイル)、(2,4-ジアミノ フェノキシ) パルミテート、(2,4-ジアミノフェノ キシ) ステアリレート、(2,4-ジアミノフェノキ シ) -4-トリフルオロメチルベンゾエート、上記式 (1) および(2) で表される化合物が好ましく、4, 4'ージアミノジフェニルメタン、3,3'ージメチル -4,4'-ジアミノビフェニル、4,4'-ジアミノ ジフェニルエーテル、1-ヘキサデカノキシー2,4-ジアミノベンゼン、1-オクタデカノキシ-2, 4-ジアミノベンゼン、1-コレステリルオキシー2,4-ジ アミノベンゼン、1-コレスタニルオキシー2,4-ジ アミノベンゼン、ヘキサデカノキシ(3,5-ジアミノ ベンゾイル)、オクタデカノキシ(3,5-ジアミノベ ンゾイル)、コレステリルオキシ(3,5-ジアミノベ ンゾイル)、コレスタニルオキシ(3,5-ジアミノベ ンゾイル)、(2,4-ジアミノフェノキシ)パルミテ ート、(2,4-ジアミノフェノキシ)ステアリレー ト、(2,4-ジアミノフェノキシ)-4-トリフルオ ロメチルベンゾエート、上記式(1)および(2)で表 される化合物が特に好ましい。これらは単独でまたは2 種以上を組み合わせて使用できる。

【0027】液晶配向剤

本発明において用いられる液晶配向剤は、前記ポリアミック酸を含有する溶液からなる。

【0028】この際用いられる溶剤としては、ポリアミック酸を溶解し得る有機溶剤であれば特に制限はなく、例えば、Nーメチルー2ーピロリドン、N, Nージメチルアセトアミド、N, Nージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ケーブチロラクトン、テトラメチル尿素、ヘキサメチルホスホルトリアミドなどの非プロトン系極性溶媒;mークレゾール、キシレノール、フェノール、ハロゲン化フェノールなどのフェノール系溶媒を挙げることができる。これらは、単独または2種以上の溶剤を組み合わせて使用できる。なお、前記溶剤には、

ポリアミック酸の貧溶媒を、重合体が析出しない範囲で 併用することができる。

【0029】本発明において用いられる液晶配向剤は、プレチルト角の安定化および塗膜強度アップのために、種々の熱硬化性の架橋剤を含有することもできる。熱硬化架橋剤としては、多官能エポキシ含有化合物が有効であり、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、環状脂肪族エポキシ樹脂、グリシジルエステル系エポキシ樹脂、グリシジルジアミン系エポキシ樹脂、複素環式エポキシ樹脂、エポキシ基含有アクリル樹脂などが使用できる。市販品では、例えばエボライト400E、同3002(共栄社油脂化学工業(株)製)、エピコート828、同152、エポキシノボラック180S(油化シェルエポキシ(株)製)などを挙げることができる。

【0030】さらに、前述の多官能エポキシ含有化合物を使用する際、架橋反応を効率良く起こす目的で、1 - ベンジルー2 - メチルイミダゾールなどの塩基触媒を添加することができる。

【0031】また、本発明の液晶配向剤は、基板との接 着性を改善する目的で、官能性シラン含有化合物を含有 することができる。官能性シラン含有化合物としては、 例えば、3-アミノプロピルトリメトキシシラン、3-アミノプロピルトリエトキシシラン、2-アミノプロピ ルトリメトキシシラン、2-アミノプロピルトリエトキ シシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロ ピルトリメトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、3-ウレ イドプロピルトリメトキシシラン、3-ウレイドプロピ ルトリエトキシシラン、N-エトキシカルボニル-3-アミノプロピルトリメトキシシラン、Nーエトキシカル ボニルー3ーアミノプロピルトリエトキシシラン、N-トリエトキシシリルプロピルトリエチレントリアミン、 Nートリメトキシシリルプロピルトリエチレントリアミ ン、10-トリメトキシイシリル-1,4,7-トリア **ザデカン、10-トリエトキシシリル-1,4,7-ト** リアザデカン、9ートリメトキシシリルー3,6-ジア ザノニルアセテート、9ートリエトキシシリルー3,6 ージアザノニルアセテート、N-ベンジル-3-アミノ プロピルトリメトキシシラン、N-ベンジルー3-アミ ノプロピルトリエトキシシラン、N-フェニル-3-ア ミノプロピルトリメトキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-ビス (オキシ エチレン) -3-アミノプロピルトリメトキシシラン、 N-ビス(オキシエチレン)-3-アミノプロピルトリ エトキシシランおよび特開昭63-291922号公報 記載のテトラカルボン酸二無水物とアミノ基含有シラン 化合物との反応物などを挙げることができる。

【0032】液晶配向膜_

本発明において用いられるポリアミック酸薄膜を形成する方法としては、例えば次の方法が挙げられる。まず、透明導電膜が設けられた基板の透明導電膜側に、ポリアミック酸を含有する液晶配向剤をロールコーター法、スピンナー法、印刷法等により塗布し、40~200℃の温度で加熱して薄膜を形成させる。薄膜の膜厚は、好ましくは0.001~1μm、より好ましくは0.005~0.5μmである。

【0033】次いで、前記ポリアミック酸薄膜に偏光または非偏光の放射線を照射し、液晶配向能を付与する。放射線としては、150nm~800nmの波長を有する紫外線および可視光線を用いることができる。320nm~450nmの波長を有する紫外線が好ましい。放射線として直線偏光ないしは部分偏光放射線を用いることができ、それを用いた場合には、照射は基板面に垂直の方向から行っても、プレチルト角を付与するために斜め方向から行ってもよく、また、これらを組み合わせて行ってもよい。非偏光の放射線を照射する場合には、照射の方向は斜め方向とする必要がある。

【0034】この放射線の光源としては、例えば低圧水銀ランプ、高圧水銀ランプ、重水素ランプ、メタルハライドランプ、アルゴン共鳴ランプ、キセノンランプ、エキシマーレーザー等が使用できる。前記の好ましい波長領域の紫外線は、フィルター、回折格子等を前記光源と併用する等の手段により得ることができるが、簡便には、偏光板として320nmより短い波長の紫外線を透過しないものを、前記光源とともに用いてもよい。

【0035】前記ポリアミック酸薄膜に放射線を照射して液晶配向能を付与する工程は、基板を室温以上の温度に加熱しつつ行うことが好ましい。この際の基板温度は、放射線の照射工程を通じて一定に保持されていてもよく、また、照射工程中に連続的または段階的に基板を昇温してもよい。

【0036】前記基板温度が放射線の照射工程を通じて一定に保持されている場合、基板温度は50~300℃の範囲であることが好ましく、150~250℃の範囲であることがさらに好ましい。また、放射線の照射工程中に、連続的または段階的に基板を昇温する場合には、その最高温度は100~300℃の範囲であることが好ましく、150~250℃の範囲であることがさらに好ましい。特に好ましい条件は、基板を室温から、150~250℃の範囲にある最高温度まで1~10℃/分の昇温速度で連続的に昇温しつつ放射線の照射を行うことである。

【0037】さらに、必要に応じて、薄膜を150~2 50℃の温度で加熱処理してイミド化反応を完全に進行 させ、液晶配向能を有するポリイミド薄膜を得る。この 加熱処理によって、放射線照射により付与された液晶配 向能はほとんど変化しない。

【0038】基板

本発明において用いられる基板としては、例えばフロートガラス、ソーダガラスの如きガラス、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエーテルスルホン、ポリカーボネートの如きプラスチックフィルム等からなる透明基板を用いることができる。これらの基板には、通常、素子を駆動するために透明導電膜が設けられる。透明導電膜としては、例えばSn〇2からなるNESA膜、In2〇3 一Sn〇2からなるITO膜等を用いることができる。これらの透明導電膜のパターニングには、フォト・エッチング法、予めマスクを用いる方法等を用いることができる。

【0039】液晶配向剤の塗布に際しては、基板および透明導電膜と塗膜との接着性をさらに良好にするために、基板および透明導電膜上に、予め官能性シラン含有化合物、チタネート等を塗布することもできる。 【0040】液晶表示素子

本発明の液晶表示素子は、前記液晶配向膜が形成された 基板を、その2枚を液晶配向膜を照射した直線偏光放射 線の偏光方向が所定の角度となるよう対向させ、基板の 間の周辺部をシール剤でシールし、液晶を充填し、充填 孔を封止して液晶セルを構成する。次いで、液晶セル を、用いた液晶が等方相をとる温度まで加熱した後、室 温まで冷却して、注入時の流動配向を除去することが望 ましい。

【0041】そして、その両面に偏光板の偏光方向がそれぞれ基板の液晶配向膜を照射した直線偏光放射線の偏光方向と所定の角度を成すように偏光板を張り合わせることにより、液晶表示素子とする。液晶配向膜が形成された2枚の基板における、照射した直線偏光放射線の偏光方向の成す角度および、それぞれの基板と偏光板との角度を調整することにより、TN型またはSTN型液晶セルを有する液晶表示素子を任意に得ることができる。【0042】前記シール剤としては、例えば硬化剤およびスペーサーとしての酸化アルミニウム球を含有したエポキシ樹脂等を用いることができる。

【0043】前記液晶としては、例えばネマティック型液晶、スメクティック型液晶などを用いることができる。TN型液晶セルの場合、ネマティック型液晶を形成するものが好ましく、例えばシッフベース系液晶、アゾキシ系液晶、ビフェニル系液晶、フェニルシクロヘキサン系液晶、ターフェニル系液晶、ビフェニルシクロヘキサン系液晶、ピリミジン系液晶、ジオキサン系液晶、ビシクロオクタン系液晶、キュバン系液晶等が用いられる。またSTN型液晶セルの場合、前記液晶に、例えばコレスチルクロライド、コレステリルノナエート、コレステリルカーボネート等のコレステリック液晶や商品名C-15, CB-15 (メルク社製)として販売されているようなカイラル剤等をさらに添加して使用することもできる。さらに、pーデシロキシベンジリデンーpーアミノー2ーメチルブチルシンナメート

等の強誘電性液晶も使用することができる。

【0044】液晶セルの外側に使用される偏光板としては、ポリビニルアルコールを延伸配向させながら、ヨウ素を吸収させたH膜と呼ばれる偏光膜を酢酸セルロース保護膜で挟んだ偏光板、またはH膜そのものからなる偏光板等を挙げることができる。

[0045]

【作用】本発明の製造方法を用いて液晶配向膜を形成すれば、通常の液晶配向膜用ポリイミド膜に十分な液晶配向能を付与することができるので、従来の光配向法によった場合に比べて熱安定性および電気特性の優れた液晶配向膜を形成できる。

[0046]

【実施例】以下、本発明を実施例により、さらに具体的 に説明するが、本発明はこれらの実施例に制限されるものではない。

【0047】なお、以下の参考例、実施例および比較例において、液晶配向膜の配向容易軸、液晶表示素子における液晶のプレチルト角および電圧保持率の測定方法は下記のとおりである。

【〇〇48】配向容易軸

液晶として、二色性色素(ジスパースレッド)をドープしたネマティック型液晶(5CB)を用いた以外は、後述する実施例および比較例における方法により、液晶表示素子を作製した。得られた液晶セルの、二色性色素による偏光吸収スペクトルを測定し、吸光度が最大となったときの偏光の方位を配向容易軸とした。

【0049】プレチルト角_.

[T. J. Schffer, et al., J. Appl. Phys., 19, 2013 (1980)] に記載の方法に準拠し、He-Neレーザー光を用いる結晶回転法により行った。

【0050】電圧保持率

60 での恒温槽内において、電圧5 V、印加時間 60μ secのパルス電圧を167m secのスパンで液晶表示素子に印加した後、当該電圧の印加を解除してから167m sec後における当該液晶表示素子の保持電圧を測定して、保持率 $[(V/5) \times 100[\%]]$ を求めた。

【0051】合成例1

ポリアミック酸の重合

3,3'ージメチルー4,4'ージアミノビフェニル 0.1 モル(21.2g)と3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物 0.1 モル(29.4g)をNーメチルー2ーピロリドン400gに溶解させ、室温で6時間反応させた。得られた溶液にNーメチルー2ーピロリドンにより希釈して固形分濃度2.5 重量%の溶液とし、さらに、この溶液を孔径1 μ mのフィルターで沪過し、ポリアミック酸(以下、重合体1aともいう)を含有する液晶配向剤を得た。

【0052】合成例2

ポリアミック酸の重合

3,3'ージメチルー4,4'ージアミノビフェニル 0.1モルに代えて4,4ージアミノジフェニルメタン 0.1モル(19.8g)を用いた他は合成例1と同様にして、ポリアミック酸(以下、重合体2aともいう)を含有する液晶配向剤を得た。

【0053】合成例3

ポリアミック酸の重合

3,3'ージメチルー4,4'ージアミノビフェニル 0.1モルおよび3,3',4,4'ービフェニルテト ラカルボン酸二無水物 0.1モルに代えて4,4ージアミノジフェニルエーテル 0.1モル(20.0g) およびピロメリト酸二無水物 0.1モル(21.8g)を用いた他は合成例1と同様にして、ポリアミック酸(以下、重合体3aともいう)を含有する液晶配向剤を得た。

【0054】合成例4

ポリアミック酸の重合

3,3'-ジメチル-4,4'-ジアミノビフェニル 0.1モルに代えて3,3'-ジメチル-4,4'-ジ アミノビフェニル 0.098モル(20.8g)およ びコレスタニルオキシ(3,5-ジアミノベンゾイル)

0.002モル(1.05g)を用いた他は合成例1 と同様にして、ポリアミック酸(以下、重合体4aともいう)を含有する液晶配向剤を得た。

【0055】参考例

合成例1で得られた液晶配向剤を、ITO膜からなる透明電極付きガラス基板上の透明電極面に、膜厚が0.1 μ mになるようにスピンナーを用いて塗布し、100 Γ で1時間乾燥し、重合体1aの薄膜を形成した。

【0056】さらに、この基板を250℃で15分、イミド化熱処理することにより、対応するポリイミド(以下、重合体1bともいう)の薄膜とした。

【0057】この薄膜に、ナイロン製の布を巻き付けたロールを有するラビングマシーンにより、ロールの回転数500rpm、ステージの移動速度1cm/秒でラビング処理を行った。

【0058】次に、一対のラビング処理された基板の液晶配向膜を有するそれぞれの外縁に、直径17μmの酸化アルミニウム球入りエポキシ樹脂接着剤をスクリーン印刷塗布した後、一対の基板を液晶配向膜面が相対するように、しかもラビング方向が直交するように重ね合わせて圧着し、接着剤を硬化させた。

【0059】次いで、液晶注入口より一対の基板間に、ネマティック型液晶(メルク社製、ZLI-1565)を充填した後、エポキシ系接着剤で液晶注入口を封止した。さらに、液晶注入時の流動配向を除くためこれを150℃に加熱した後、室温まで徐冷し、基板の外側の両面に偏光板を、偏光板の偏光方向がそれぞれの基板の液

晶配向膜のラビング方向と一致するように張り合わせ、液晶表示素子を作製した。液晶の配向性は良好であった。電圧5Vを印加したところ、印加した電圧のON-OFFに応答して、液晶表示素子の明暗の変化が観察された。

【0060】実施例1

参考例と同様にして、基板上に重合体1 aの薄膜を形成した。この基板を150℃に保持しつつ、薄膜に、高圧水銀灯により、偏光フィルターSPF-50C-32(シグマ光機製)を通して、365nmの波長を主とする直線偏光した紫外線0.5J/cm²を45度の入射角で照射した。さらに、250℃で15分間イミド化熱処理を行い、薄膜を重合体1bに変換した。

【0061】次に、液晶配向膜を重ね合わせる向きをラビング方向の代わりに紫外線の偏光方向に従った以外は、参考例と同様の方法で液晶表示素子を作製したところ、液晶の配向性は良好であった。参考例と同様の条件

で電圧を印加したところ、印加した電圧のON-OFF に応答して、液晶表示素子の明暗の変化が観察された。 【0062】この液晶配向膜の配向容易軸は、照射した 紫外線の電場ベクトルと平行であった。また、この液晶 表示素子のプレチルト角は1.2度であり、電圧保持率 は98%であった。

【0063】実施例2~4

合成例2~4で得られた、重合体2a~4aを含有する液晶配向剤を用いた以外は、実施例1と同様にして液晶配向膜および液晶表示素子を作製したところ、いずれも液晶の配向性は良好であった。実施例1と同様の条件で電圧を印加したところ、印加した電圧のON-OFFに応答して、液晶表示素子の明暗の変化が観察された。

【0064】これらの液晶表示素子のプレチルト角および電圧保持率を表1に示す。

[0065]

【表1】

実施例	重合体	プレチルト角(度)	電圧保持率(%)
1	1 b	1. 2	98
2	2 b	0.8	98
3	3 b	1. 1	9 9
4	4 b	4. 5	9 9

【0066】比較例1~4

合成例1~4で得られた液晶配向剤を用い、参考例と同様に基板上に重合体1 a~4 a の薄膜を形成した。さらに、参考例と同様にして、これを250℃で15分間熱処理し、重合体1 b に変換した。この薄膜に、実施例1と同様にして直線偏光紫外線照射を行い、得られた液晶配向膜を用いて液晶表示素子を作製した。

【0067】これらの液晶表示素子においては、液晶の配向は観察されたが、ディスクリネーション欠陥が見られ、配向性は良くなかった。また、これらの液晶配向膜の配向容易軸は、いずれも照射した紫外線の電場ベクトルと垂直方向であり、いずれの素子においても、プレチルト角は0度であった。

[0068]

【発明の効果】本発明の液晶配向膜の製造方法によれば、通常の液晶配向膜用ポリイミドからなる薄膜に十分な液晶配向能を付与できるため、従来の光配向膜より、耐熱性および電気特性の優れた液晶配向膜が形成できる。また、本発明の液晶配向剤を用いて形成された液晶配向膜は面内均一性に優れているため、TN型、STN型等の表示用として用いた場合に高い表示品位を持つ液晶表示素子が得られ、種々の装置に有効に使用でき、例えば卓上計算機、腕時計、置時計、計数表示板、ワードプロセッサ、パーソナルコンピューター、液晶テレビなどの表示装置に好適に用いられる。

フロントページの続き

Fターム(参考) 2H090 HB08 HC05 HC16 HC19 KA05

KA08 MA02 MA10 MB12 MB13

4J043 PA19 QB15 QB26 QB31 RA35

RA39 SA43 SA46 SA47 SA52

SA54 SA63 SA72 SB01 SB02

TA22 TA71 TB01 TB02 UA022

UA032 UA061 UA082 UA121

UA122 UA131 UA132 UA141

UA142 UA151 UA152 UA221

UA231 UA241 UA251 UA261

UA262 UA622 UA632 UA652

UA662 UA672 UA711 UA761

UB011 UB021 UB061 UB062

UB121 UB122 UB131 UB132

UB151 UB171 UB221 UB281

UB282 UB301 UB302 UB312

UB382 UB401 UB402 VA011

VA021 VA022 VA031 VA032

VA041 VA051 VA062 VA071

VA072 VA081 XA16 XA17

XA19 ZB21 ZB23